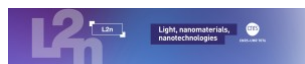

Programme de Formation

Lithographie laser avancée multi-échelles



Organisation

Durée : 21 heures

Mode d'organisation : Présentiel

Contenu pédagogique



Public visé

Ingénieurs ou chercheurs des secteurs publics ou privés



Objectifs pédagogiques

- Connaître les principes fondamentaux et opératoires de la photolithographie 3D par impression laser directe à l'échelle sub-micrométrique
- Acquérir des connaissances fondamentales et appliquées concernant la lithographie par interférences laser et les techniques de nanofabrication associées
- Être capable de fabriquer des structures hybrides 3D à grande échelle, nanostructurées à l'aide de colloïdes, en sélectionnant et en combinant les techniques de structuration laser les plus adaptées



Description

1er jour

- Introduction à la photostructuration (sources, équipements utilisés...)
- Cours théorique sur les technologies d'écriture directe par laser femtoseconde (EDLF) et lithographie interférentielle laser (LIL)
- Étude théorique des techniques associées (fonctionnalisation de surface, dépôt par voie chimique, gravure, croissance chimique, PVD, transfert, etc.)
- Design des structures et paramétrage pour l'EDLF
- Mise en place d'un montage LIL grande échelle

2ème jour

- Fabrication de structures 3D par EDLF sur photopolymère et étude des techniques associées (dépôt de particules métalliques/fluorescentes)
- Fabrication de structures par LIL et étude des techniques associées

3ème jour

- Caractérisation des échantillons réalisés : photoluminescence, FLIM, MEB, spectroscopie Raman, micro-extinction, angle de contact, sphère intégrante...
- Validation des acquis de la formation





Prérequis

Prérequis : connaissances de base en optique/laser (niveau master) et intérêt pour la micro et la nanostructuration



Modalités pédagogiques

Alternance de cours théoriques (3 h) et de travaux pratiques (15 h).



Moyens et supports pédagogiques

Un livret récapitulatif du cours sera remis au stagiaire à l'issue de la formation.

Équipements de la plateforme nano'mat pour la nanofabrication (Nanoscribe, Bati de gravure, évaporateurs...) et la caractérisation (AFM, MEB, angle de contact, FLIM, bancs de spectroscopie optique...).

Voir le site de la plateforme nano'mat pour une description détaillée des équipements.



Modalités d'évaluation et de suivi

Un suivi individualisé par des évaluations formatives est assuré. Une attestation de fin de formation est délivrée à la fin du parcours.



Informations sur l'admission

L'admission à cette formation ne fait l'objet d'aucun examen, test ou sélection préalable ; l'inscription est validée après réception du dossier complet et confirmation par l'organisme de formation.



Informations sur l'accessibilité

Notre organisme s'engage à garantir l'accessibilité de ses formations à distance et en présentiel aux personnes en situation de handicap. Un référent handicap est mobilisable afin d'analyser les besoins spécifiques et de mettre en place, lorsque cela est possible, les adaptations pédagogiques, techniques ou organisationnelles nécessaires.